



再公表特許廃止による調査分析での注意点

日本特許件数の集計と出願動向把握

○中島 勇¹⁾²⁾, 高井 史比古³⁾, 田中 厚子⁴⁾, 小川 隆司⁵⁾, 本田 孝行⁶⁾

川本 敦子⁷⁾, 西川 幸江⁸⁾, 青野 嘉之⁹⁾, 堀越 節子¹⁰⁾

日本 EPI 協議会^{1) 注 1)}

<http://jea-ip.info/wp/>

SUBARU テクノ株式会社²⁾

株式会社パスコ³⁾

信越ポリマー株式会社⁴⁾

大日本印刷株式会社⁵⁾

株式会社リコー⁶⁾

株式会社東芝⁷⁾

ギガフォトン株式会社⁸⁾

ニデック株式会社⁹⁾

中央光学出版株式会社¹⁰⁾

Considerations for search and analysis due to the abolition of domestic re-publication of PCT International

Isamu NAKASHIMA¹⁾²⁾, Fumihiko TAKAI³⁾, Atsuko TANAKA⁴⁾

Takashi OGAWA⁵⁾, Takayuki HONDA⁶⁾, Atsuko KAWAMOTO⁷⁾

Yukie NISHIKAWA⁸⁾, Yoshiyuki AONO⁹⁾, Setsuko HORIKOSHI¹⁰⁾

Japan EPI Association¹⁾

<http://jea-ip.info/wp/>

SUBARU TECHNO CORPORATION²⁾

PASCO Corporation³⁾

Shin-Etsu Polymer Co., Ltd⁴⁾

Dai Nippon Printing Co., Ltd⁵⁾

Ricoh Company, Ltd⁶⁾

TOSHIBA Corporation⁷⁾

Gigaphoton Inc⁸⁾

Nidec Corporation⁹⁾

CHUO KOUGAKU SHUPPAN Co., Ltd¹⁰⁾

【発表概要】

2022 年 1 月以降, 特許庁が日本語 PCT 出願の国内移行情報である再公表特許を廃止したことにより, 再公表特許を利用した件数集計ができなくなった。近年は, PCT 出願の利用を増やす日系企業も見受けられ, 再公表特許廃止の影響は大きくなっている。このような背景により, PCT 出願を含む日本特許の出願件数を正確に把握するには, 制度, 検索システムを理解し, 目的に応じて件数集計することが重要となっている。

以上から, 日本 EPI 協議会では, 日本特許の件数集計において再公表特許の廃止による影響を調べるとともに, 望ましい集計方法を研究した。

【キーワード】

再公表特許，特許調査分析，特許検索システム

1. はじめに

特許情報を用いた技術動向調査やベンチマーク調査では出願件数の把握は必須であり，どの国に何件の特許出願がなされているのか，また，その件数が増加しているのか，減少しているのかを正しく捉えることが重要である。

2022 年 1 月より再公表特許が廃止されたことを受けて，日本 EPI 協議会^{注1)}では，再公表特許の廃止が件数の集計に与える影響を調べるとともに，望ましい集計方法を研究した。

2. 再公表特許廃止の影響

日本特許の出願件数は従来，表1に示す日本特許の公報数を集計することで把握できた。

表 1. 日本国特許庁への特許出願と公報の種類

出願形態	日本特許	公開	登録
通常の日本出願	○	A 公開特許公報	B 特許公報
日本語 PCT 出願 JP 移行有り	○	S 再公表特許 2022 年から廃止	
外国語 PCT 出願 JP 移行有り	○	T 公表特許公報	
日本語 PCT 出願 JP 移行無し	—	国際公開公報	—

再公表特許の廃止により，日本語PCT出願を利用する企業の件数集計に影響を及ぼすこととなった。従来のように日本特許庁発行の公報件数だけでは出願動向を把握することができなくなり，再公表特許に代わる日本語 PCT 出願の移行情報を取得する必要性が生じた。そこで，審査経過情報を利用した集計を試みた。検索システムによっては，日本出願番号の有無で国内移行を判断することもできる。関連の検索手法については 3 章で述べる。

集計結果の違いを把握するため，公報発行数と，審査経過情報をもとに集計した件数とを比較した。具体的な方法として，表1に示す公報 A, B, S, T の何れかの公報が存在する出願の合計数(集計①)と，審査経過情報をもとに集計した実際の出願数(集計②)とをそれぞれ算出の上，再公表特許廃止の影響の程度としてその差(集計②－①)と差の割合(集計②－①)/集計②＊100を算出した。算出結果を表 2 および図 1 に示す。

集計対象は国際公開公報の件数が日本企業中トップ^{注2)}の三菱電機社の出願とした。

表2. 三菱電機社の日本特許の出願件数

集計	集計方法	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
①	日本特許庁が発行した公報(表1記載の A, B, S, T)の何れかが存在するもの	4,510	4,277	3,697	2,892	1,782	421
②	通常の日本出願に日本に移行済みの PCT 出願を加えたもの(審査経過情報により検索)	4,512	4,334	3,977	3,643	2,028	423
集計②-①		2	57	280	751	246	2
(集計②-①)/集計②*100		0%	1%	7%	21%	12%	0%

※歴年は出願年

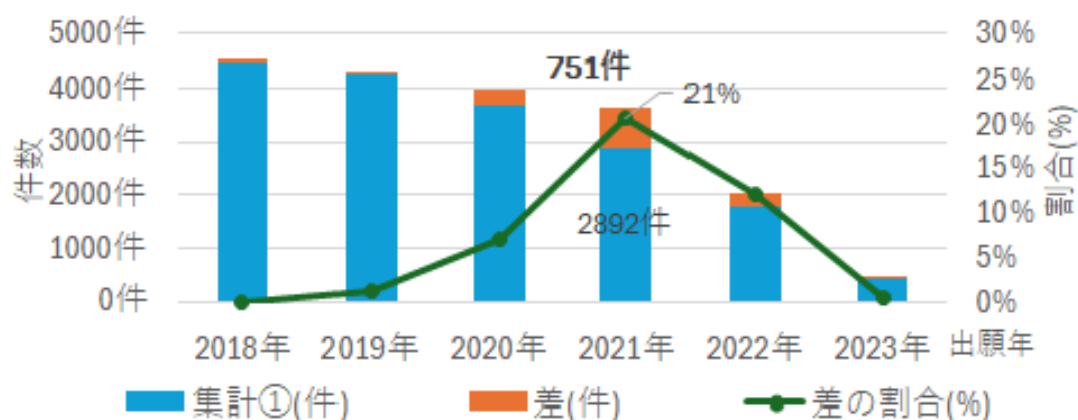


図1. 再公表特許廃止の影響

表 2 および図1のとおり、公報発行数による日本特許の件数(集計①)は実際の出願数(集計②)よりも 2021 年の出願で 751 件少なく集計された。その差は同年の実際の出願数の 21%に及ぶ結果となった。これは再公表特許廃止の影響であり、影響は大きく技術動向やベンチマークの結果を見誤りかねない。

3. 移行情報に基づく検索手法

2 章で述べた問題に対応するため、主に日系ベンダーの各社は、日本語 PCT 出願を日本特許データベースに蓄積するとともに、検索機能を提供してきた。

従来から、日本語 PCT 出願は国内書面の提出有無等の審査経過情報から国内移行されているかどうかの条件で検索することができ、検索結果を集計することで件数を把握できる。表 3 は 5 つの検索システムを例として、審査経過情報を用いた国内移行情報の検索方法と、国内移行された日本語 PCT 出願を効率よく検索するための検索方法を整理したものである。

表 3. 検索システム別の検索手法

検索システム	PCT出願全体の日本移行検索	日本語 PCT の日本移行検索
PatentSQUARE [国内]	審査中間 C(経):A632	検索対象:2
	中間コード 国内書面	国内公開化のみ
NewCSS [日本特許 DB]	IM=A632	IM=AIB3491 AND AN=*
	中間コード 国内書面	日本語国際公開×出願番号
HYPAT-i2[国内]	L_EIC:A632	L_DNP:yyyymmdd:yyyymmdd
	審査中間コード 国内書面	国内移行日
PatSnap	PCTENTRY_TYPE:1	PN=JPWO
	PCT 国内移行あり	
Patentfield	AMC=A632	公開種別:KND=A0
	中間コード 国内書面	独自再公表用種別

4. 望ましい集計方法

3 章で述べた集計方法は国内移行された出願を集計するものであり、国内移行前の出願は集計対象にならない。国内移行前の出願がどの程度、存在するかを三菱電機社の出願を例に調べた。図 2 は三菱電機社の 2021 年と 2022 年の PCT 出願を次の 3 形態に分けたものである。

- (1) 国内移行済み ……国内に移行済みの出願
- (2) JP 指定有り ……日本を指定国に含む国内移行前の出願
- (3) JP 除外 ……日本を指定国に含まない出願

三菱電機社における(2)JP 指定有りの出願は 2022 年で 1,140 件あり、これを集計に加えるかどうかで結果の意味するところは変わる。これまで、三菱電機社の PCT 出願においては、約9割が日本に移行されてきた。競合他社の直近の動向を把握するにあたっては、移行可能性のある出願を考慮する必要がある。具体的には、2 章で述べた表 2 の②国内移行済みの出願件数と共に、(2)JP 指定有りを集計しておくのが望ましい。

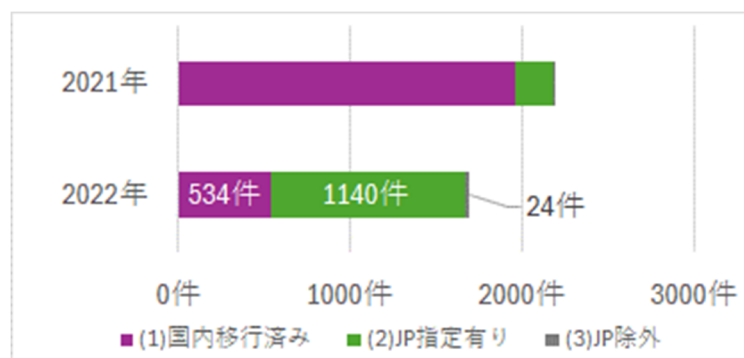


図 2. PCT 出願の内訳

上記 3 形態の内の(3)JP 除外は、日本を指定国に含まない出願であるため日本特許には該当しない。集計から除外すべきであるが、除外するには日本指定の有無を判定しなければならず集計作業が複雑になる。集計対象に含めると、基礎出願が存在する出願であることから同じ内容が重複して集計することにもなる。基礎出願は PCT 出願ではない通常出願として集計される。

指定国の判定が複雑になる理由として、その判定を可能にする検索システムが少ないことが挙げられる。外国特許系の検索システムにおいては、指定国の検索や表示・ダウンロードが可能なものが多い。しかし、日本特許庁発行の公報とともに日本語 WO 公報を同時に検索できる日本特許系の検索システムにおいては、日本語 WO 公報の出願が日本を指定国にしているかどうかを検索コマンドで判定できるものは少ない。

表 3 に示した検索システムの中では NewCSS[日本特許 DB]が判定可能であった。どこまで正確に集計するのかについては、表 4 のメリット、デメリットを把握の上で調査や分析の目的に応じて判断するのが望ましいと考えられる。

表 4. 集計範囲別のメリット、デメリット

集計範囲	メリット	デメリット
(1)+(2)+(3)	複雑な検索不要	基礎出願との重複カウント
(1)+(2)	移行可能性のある出願を集計できる	国内移行されなかった出願を含む
(1)	実際に移行された出願を把握できる	国内移行期間終了まで件数が確定しない

5. おわりに

再公表特許廃止の影響として、集計の仕方によっては日本特許の件数を少なく捉えることになる。近年 PCT 出願の利用を増やす日本企業もあり、今後その影響は大きくなる。技術動向の把握やベンチマークを適切に実行するには、これまでの集計方法を必要に応じて見直す必要があり、今はその時期にあると考えられる。技術動向を定点観測するための検索式や SDI 配信のための検索式の見直しについても同様である。

また、検索システムの機能が充実され、再公表特許を利用せずに集計できるようになっている。検索システムの特性を理解するとともに、調査分析の目的に応じて集計範囲、検索システムを選ぶことも重要である。

注・参考文献

- 注 1) 日本 EPI 協議会は 1981 年に設立、会員の関心が高いテーマで研究や意見交換等を行っている。(http://jea-ip.info/)。
 注 2) 特許庁「特許行政年次報告書 2023 年版」,p159